## 福岡工業大学 機関リポジトリ

# **FITREPO**

Title	垂直磁界中で厚み方向に等間隔配置された超伝導薄板列内の電 流前線
Author(s)	野田稔
Citation	福岡工業大学研究論集 第43巻2号(通巻66号) P93-P97
Issue Date	2011-2
URI	<u>http://hdl.handle.net/11478/1290</u>
Right	
Туре	Departmental Bulletin Paper
Textversion	Publisher

# Fukuoka Institute of Technology

### 野田稔(電子情報工学科)

### Current Fronts in Superconducting Thin Plates Aligned in Order with Face to Face Periodically under a Perpendicular Magnetic Field

Minoru NODA (Department of Information Electronics)

#### Abstract

A vertical alignment of superconducting thin plates in order with face to face under a perpendicular magnetic field gives some influence on a configuration of a shielding current front in each plate. In the case of inverse aspect ratio  $\alpha = 0.01$  and normalized interval between adjacent plates  $\gamma = 3$ , a current front is determined numerically by magnetic shielding conditions. Calculation results including contributions of many adjacent plates show that a current region width is extremely small in a vertical alignment of plates, compared with the case of a horizontal alignment. The flux penetration is effectively prevented from current groups in plates in vertical positions.

Key words: vertical alignment of superconducting thin plates, perpendicular field, aspect ratio, shielding current front curve, interval between adjacent plates

#### 1. はじめに

超伝導テープの巻線パンケーキ・コイルで,多層巻ソレ ノイド・コイルをつくり,電流を流すとコイル端部に斜め 磁界が加わる。すなわち,テープ面に垂直な磁界成分が現 れる。垂直磁界が交流変化した場合,超伝導薄板に発生す る交流損失は,薄板の幅が大きいほど損失密度が大きくな るので,その影響を調べることは重要である。

これまでに、本研究では、超伝導薄板が単独に存在する 場合と、薄板の横方向列集団がある場合について、薄板内 の電流分布をアスペクト比や外部磁界の関数として数値的 に決定してきた。<sup>1-6)</sup>多層巻ソレノイド・コイルの場合は、 テープの厚み方向に積み重ねられたテープ列集合がある。 その場合、薄板内の電流分布がどのように変わるかを知る ことは実際上の応用面からみて必要である。

本研究では,超伝導薄板の厚み方向列の存在がどの程度 薄板内の電流分布に影響を与えるかを調べることを目的と する。近接する薄板列の上下5層までの寄与をとり,電流 前線パラメータを決定する。その際に用いる遮蔽条件は, 平板中心での磁界ゼロとその付近での磁界変化の2次微係 数ゼロである。平板列の影響の度合いは,薄板幅に対する 板厚み,すなわちアスペクト比によっても変わると考えら

平成22年10月26日受付

れるが、今回は、アスペクト比が100の場合に固定した。数 値計算には MATLAB<sup>7)</sup>を用いた。

#### 2. 前線形状の式と遮蔽条件

直交座標 (X, Y, Z) において, Z方向に無限長で, X 方向の幅  $2D_x$ , Y方向の厚み  $2D_Y$  を持つ超伝導平板が, Y 方向に等間隔に配置されている。隣接する平板の中心間隔 を  $L_Y$  とする。平板面に垂直な方向 (Y方向) に磁界  $H_e$  が かかる場合を考える。平板内部を磁気遮蔽するための超伝 導電流はZ方向に流れる。逆アスペクト比を  $\alpha = D_Y/D_X$  で 与え, 規格化座標  $x = X/D_x$ ,  $y = Y/D_Y$  を導入する。また, 上下隣接平板の中心間隔  $L_Y$  を  $D_Y$  で規格化したパラメー タを  $\gamma = L_Y/D_Y$  とする。

図1に,規格化座標で表した平板列を示す。 $\gamma > 2$ である。 図1中の座標原点を中心にもつ平板に対し,上下の $y = \pm \gamma$ を中心とする平板①,①を"第1近接平板"と呼ぶこ とにする。図1には描かれていないが,平板①の上側,① の下側には $y = \pm 2\gamma$ を中心とする"第2近接平板"②,② がある。さらに,その上下外側に"第3近接平板"(中心 $y = \pm 3\gamma$ ),"第4近接平板"(中心 $y = \pm 4\gamma$ ),"第5近接平板" (中心 $y = \pm 5\gamma$ ),…のように平板列をなしているとする。 次に,外部磁界 $H_e$ の規格化量を

 $h_{\rm e} = H_{\rm e}/H_{\rm pB}$ ;  $H_{\rm pB} = (2/\pi)J_{\rm c}D_Y$  (2.1) で与える。超伝導平板中を流れる超伝導電流の密度  $J_{\rm c}$ は一



図1 平板に垂直な磁界中で,磁界方向に重ねられた薄い 超伝導平板列。水平,垂直方向の規格化座標(x, y), および上下隣接平板中心間隔の規格化パラメータ γ の定義は本文参照。

定と仮定する。磁界  $H_{\text{PB}}$  は,幅  $2D_Y$ のスラブ面に平行磁界 がかかった場合における中心到達磁界  $J_c D_Y$ の  $(2/\pi)$ 倍の 値をもつ量である。

座標原点を平板中心に持つ平板内の電流前線の規格化位置  $x_{\rm F}(y)$ は、既報<sup>5)</sup>に示したように、薄板の極限 (Brandt & Indenbom<sup>8)</sup>, Yamafuji et. al.<sup>9)</sup>)の議論にもとづき、

$$|x_{\rm F}(y)| = \frac{x_{\rm F0}}{\sqrt{1 + (\nabla/T)^2}}$$
 (2.2)

の形で与えられるとする。ここに、

$$T = \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(1 - |y|\right)\right) \tag{2.3}$$

である。また,  $x_{F0}$  は電流前線が x 軸を切る位置, つまり  $x_{F0} = x_{F}(0)$  であり, 区間  $x_{F0} < |x| < 1$  では電流が板厚全体にわたり分布する。(2.2) と(2.2) 式より, 電流前線の形  $x_{F}(y)$  は図 2 のように与えられる。これは図 1 の中心平板の第 1 象限における前線曲線に対応している。パラメータ  $\nabla$  が大きくなるほど, 前線形状は直線的になってゆくことがわかる。

 $x_{F0} \geq \nabla$ は一般に規格化磁界  $h_e$ と逆アスペクト比 a および平板列間隔パラメータ  $\gamma$ に依存するパラメータであり、これを数値的に定めることが電流分布の決定とみなせる。

電流前線で囲まれた被遮蔽領域内では磁界が完全にゼロ となるべきだが,式(2.2)の電流前線は近似曲線なのですべ てをゼロにはできない。そこで,原点付近で*x*軸上の磁界 を*x*で展開したときの初項と第2項がゼロとなるように与 えることにする。すなわち,原点における磁界がゼロ,お よび原点付近の磁界の2次微係数がゼロという条件を与え



図 2 平板内の電流前線の規格化位置  $x_{F}(y)$  を与える (2.2), (2.3)式を図示した結果。横軸はx軸上の前線 の規格化位置  $x_{F0} \equiv x_{F}(0)$  で規格化している。

て,2つの電流前線パラメータ x<sub>F0</sub> と ∇ を定める。原点の 磁界遮蔽条件は,既報<sup>5)</sup>の(2.12)式より次式で与えられる。 h<sub>e</sub>=(1/2)S<sub>1</sub>(1) (2.4)

 $h_{\rm e} = (1/2)S_{\rm I}(1)$  (2.4) ただし、 $S_{\rm I}(1)$ は次式より与えられる積分量の  $y \rightarrow 1$  極限で ある。

$$S_1(y) \equiv \int_0^y f_1(y_0) \mathrm{d}y_0$$
 ; (2.5)

$$f_{\rm l}(y) \equiv \ln\left(\frac{1+\alpha^2 y^2}{x_{\rm F}(y)^2 + \alpha^2 y^2}\right) + \ln(P_{\rm l}(y))$$
(2.6)

$$P_{1}(y) \equiv \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1 + \alpha^{2}(k\gamma + y)^{2}}{x_{F}(y)^{2} + \alpha^{2}(k\gamma + y)^{2}} \times \frac{1 + \alpha^{2}(k\gamma - y)^{2}}{x_{F}(y)^{2} + \alpha^{2}(k\gamma - y)^{2}} \quad (2.7)$$

(2.6)式の右辺は,第1項が平板1枚単独で存在するとき の寄与であり,第2項ln(*P*<sub>1</sub>(*y*))は,上下の平板列群からの 寄与である。(2.7)式において,番号 *k*=1, 2, 3,…が,第 1, 2, 3,…近接平板の各寄与を表している。

x軸上原点付近の磁界変化の2次微係数がゼロになる条件は、既報<sup>5)</sup>と同様に

$$0 = R - S_2(1) \tag{2.8}$$

と表される。ここに, Rは次式より与えられる。

$$R \equiv \frac{1}{1+a^2} + R_1 \quad ; \tag{2.9}$$

$$R_{1} \equiv \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{k\gamma + 1}{1 + \alpha^{2}(k\gamma + 1)^{2}} - \frac{k\gamma - 1}{1 + \alpha^{2}(k\gamma - 1)^{2}} \right)$$
(2.10)

(2.9)式の右辺は,第1項が平板1枚単独で存在するときの寄与であり,第2項 *R*<sub>1</sub>は,上下の平板列群からの寄与である。(2.10)式において,番号 *k*=1,2,3,…が,第1,2,3,…近接平板の各寄与を表している。

また, 
$$S_2(1)$$
は次式の  $y \rightarrow 1$ 極限より与えられる。

$$S_2(y) \equiv \int_0^z f_2(y_0) \mathrm{d}y_0 \tag{2.11}$$

$$f_2(y) \equiv \frac{x_{\rm F}(y)^2 - a^2 y^2}{(x_{\rm F}(y)^2 + a^2 y^2)^2} + Q_2(y)$$
(2.12)

$$Q_{2}(y) \equiv \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{x_{\mathrm{F}}(y)^{2} - a^{2}(\gamma + y)^{2}}{\{x_{\mathrm{F}}(y)^{2} + a^{2}(\gamma + y)^{2}\}^{2}} + \frac{x_{\mathrm{F}}(y)^{2} - a^{2}(\gamma - y)^{2}}{\{x_{\mathrm{F}}(y)^{2} + a^{2}(\gamma - y)^{2}\}^{2}} \right) \quad (2.13)$$

(2.12)式の右辺は,第1項が平板1枚単独で存在すると きの寄与であり,第2項 Q<sub>2</sub>(y)は,上下の平板列群からの 寄与である。(2.13)式における番号 k=1,2,3,…が,第 1,2,3,…近接平板の各寄与を表している。

#### 3. 電流前線形状パラメータ ▽ と *x*<sub>F0</sub>の関係

本報告の計算では簡単のため、逆アスペクト比  $\alpha$ =0.01 に固定する。本節では、平板と平板の間隙を厚み半幅にし た場合、すなわち、 $\gamma$ -2を1に等しくとる場合を考える。 よって、 $\gamma$ =3である。この場合、x軸上原点付近の磁界変 化の2次微係数がゼロになる条件式(2.8)を満たすように、 前線形状パラメータ  $\nabla$  と  $x_{F0}$ の組を数値的に求めた。その 結果の  $\nabla$  と  $x_{F0}$ の関係を図3のグラフに示す。また、横軸 に  $1-x_{F0}$ を、縦軸に $\nabla$ を両対数でプロットしたグラフを図 4 に示す。

両図とも、実線曲線が6本、点線曲線が1本描かれてい る。実線曲線6本には0から5までの番号が付してあり、 点線曲線には記号Pをつけている。実線の番号0の曲線は 平板が1枚単独で存在するときの結果である。

番号1の曲線は"第1近接平板"①,①'まで含めた結果 であり,番号2の曲線は"第2近接平板"②,②'まで含め た結果,同様に,番号3,4,5の曲線は,それぞれ"第 3近接平板","第4近接平板","第5近接平板"の寄与ま で取り入れた結果である。記号Pをつけた点線曲線は,前 稿で求めた平板の左右群列の結果の一つで,左右5個ずつ 含めた場合を示している。これは,実線の番号5に示した y方向の平板群列上下5個の結果と対比できるものであ る。

図3において、前線形状パラメータ $\nabla$ と $x_{F0}$ の関係は、 まず番号0の曲線が示すように、単独平板では $x_{F0}$ が値1 から小さくなるにつれ $\nabla$ は速やかに大きくなる傾向を持 つ。これは、磁界が増えてきて $x_{F0}$ が値1から小さくなる と、図2の前線形状が $\nabla$ の小さな角ばった曲線から、 $\nabla$ の 大きな直線的な曲線へ移行する様子に対応している。図3 の番号1~5の曲線群も、だいたい同様の傾向を持つが、



図3 α=0.01, γ=3の場合,前線形状パラメータ∇と x<sub>F0</sub>の関係。図中番号0の実線は単独平板の場合。番号1~5の実線は上下近接平板の寄与を入れた場合。記号Pの点線は、左右近接平板5個のときの結果。



図4 図3と同様の条件で、横軸に $1-x_{F0}$ を、縦軸に $\nabla$ を とり、両対数目盛でプロットしたグラフ。曲線の意味 は図3と同じ。

番号 0 の曲線よりかなり下に位置し、番号が大きいほど  $\nabla$ 値の小さな側へずれている。これより、平板列の影響は  $\nabla$ 値を小さくする向きに、すなわち前線が角ばった形状をな るべく維持するように現れることがわかる。記号Pの点線 曲線は左右 5 個平板群列の結果だが、 $x_{F0}$  が値 1 に近い付 近で実線群と大きな相違が出ており、前線が角ばった形状 のまま内部に侵入することを示している。

番号 1~5 の曲線群は  $x_{F0}$  が0.2~0.4付近で又値の ピークをとり、 $x_{F0}$ の小さな領域で下がっている。y方向に 重ねられた平板群は、究極的には磁界方向に平行に延びた スラブと同じになると予想され、その場合には、前線はス ラブ表面に平行な線となるため、前線が y 軸上の平板表面 を通ると仮定した現在のモデルが有効でなくなる。このよ うな事情が x<sub>F0</sub>の小さな領域で起こり始めた結果、角ばっ た形状に戻ったのではないかと推察される。

図4では、 $x_{F0}$ が値1に近く、 $1-x_{F0}$ が小さくなる微小磁 界範囲において、全部の曲線が対数的に平行な直線群に なっており、その直線の傾きより $\nabla$ は $1-x_{F0}$ に比例する ことがわかる。既報<sup>5)</sup>より番号0の曲線は十分低磁界で近 似式

 $\nabla = (0.7/a)(1-x_{F0})$ により表される。番号 5 は番号 0 の曲線よりも約 1 桁下, 番号 P は番号 0 の曲線よりも約 3 桁下と見積もられる。平 板列を構成すると単独平板よりも  $\nabla$  値は下がるが,左右方 向(*x*方向)に配置するよりも上下方向(*y*方向)に重ね て配置するほうが $\nabla$ 値は 2 桁ほど大きいことがわかる。

#### 4. 前線パラメータの磁界依存性

 $a=0.01 \ge \gamma=3$ の場合に,前節で得られた解の組( $x_{F0}$ ,  $\nabla$ )を使って(2.4)~(2.7)の数値計算を行い,規格化磁界  $h_e$ を求める。その組( $x_{F0}$ ,  $\nabla$ ,  $h_e$ )より, $\nabla$ の磁界依存性を 表したグラフを図5に示す。また, $1-x_{F0}$ の磁界依存性を 表したグラフを図6に示す。両図とも両対数目盛なので十 分低磁界までの結果を表している。図中,実線曲線の番号 0~5と,点線曲線(記号P)の意味は,図3,図4と同 じである。



図 5 α=0.01, γ=3の場合,横軸に規格化磁界 he をとり,∇の磁界依存性を両対数目盛で表したグラフ。曲線の意味は図3と同じ。

図 5 において、前線形状パラメータ  $\nabla$  と  $h_e$  の関係は、ま ず番号 0 の曲線が示すように、単独平板のとき  $h_e < 10^{-1}$ の

微小磁界範囲では,直線  $\nabla = h_e$  あるいは  $\nabla = \tanh h_e$  と一 致する(既報<sup>5</sup>))。この低磁界範囲では,番号 0 ~ 5の曲線 群は平行で,番号が大きくなる程  $\nabla$  値は小さい側に来てい る。記号 P の点線曲線が番号 0 の単独平板とあまり変わら ないのに比べると,番号 5 の実線の  $\nabla$ 値は番号 0 の約1/7に 小さくなっている。低磁界  $h_e < 10^{-1}$  での前線形状の角ばり 傾向は,上下方向に重ねられた平板群によって一層角ばる ことになる。



図 6 図 5 と同様の条件で、1-*x*<sub>F0</sub>の磁界依存性を両対数 目盛で表したグラフ。曲線の意味は図 3 と同じ。

次に、図6によると、 $1-x_{F0}$ は $h_e < 10^{-2}$ の小さな微小磁 界範囲において、全部の実線曲線 $0 \sim 5$ がほぼ一致する。 よって、この磁界範囲では、上下方向に重ねられた平板群 の影響がほぼなく、単独平板の場合と変わらないという結 果を得た。単独平板の場合、微小磁界範囲では、既報<sup>5</sup>より、

 $1-x_{F0}=(a/0.7) h_e$  (4.1) で表わされるので、これが上下平板列の場合も  $h_e < 10^{-2}$ の 範囲で適用できることになる。

一方、 $h_e < 10^{-2}$ の大きな磁界範囲では、番号0よりも番号1~5の曲線がだんだん下側に移動していき、番号5はむしろ(4.1)式の直線に近づくように見える。これは、上下隣接平板電流は当該平板の磁気遮蔽を強め、磁束侵入を妨げるように働くから、平板数が多いほど当該平板の電流領域を減らしてもよいことから理解される。

図6の点線(P)に比べ,低磁界では実線が3桁ほど小さい。これは、上下平板配列よりも1層の左右平板列配置の 方が、平板端部の前線形状に与える影響が圧倒的に大きい ことを表している。1層の左右平板列配置の場合、隣の平 板電流が磁気遮蔽を弱めるので、その分を当該平板の電流 領域を増して遮蔽を賄う必要がある。そのため、単独平板 の場合よりも前線がより内部へ動くことは、前報<sup>60</sup>の結果 で明らかである。

#### 5.まとめ

本報告では, 逆アスペクト比  $\alpha$ =0.01 に固定した。上下方向の平板列間隔パラメータ  $\gamma \in \gamma$ =3 の場合に設定して, 電流線のパラメータ ( $\nabla$ ,  $x_{F0}$ )およびその磁界依存性が, 平板列の影響をどの程度受けるかを調べた結果,

- (1) 単独平板の場合と同様に, x<sub>F0</sub>が1から小さくなる につれ∇は速やかに大きくなる傾向を持つ。但し、単 独平板に比べると上下平板列の影響は、∇値を小さく する向きに、すなわち前線が角ばった形状をなるべく 維持するように現れる。
- (2) 平板列を構成すると単独平板よりも∇値は下がる が、微小磁界範囲では、左右方向(x方向)に配置する 場合に比べ、上下方向(y方向)に重ねて配置するほう が∇値は2桁ほど大きい。
- (3) 低磁界 he<10<sup>-1</sup> での前線形状の角ばり傾向は、上下
   (y)方向に重ねられた平板群によって一層角ばる影響を受ける。
- (4) h<sub>e</sub><10<sup>-2</sup>の小さな微小磁界範囲において, x 軸上の 電流領域幅1-x<sub>F0</sub>は単独平板の場合と変わらない磁 界依存性を示し,上下(y)方向に重ねられた平板群の 影響がほぼない。
- (5) 比較的大きな磁界範囲 h<sub>e</sub>>10<sup>-2</sup>では、電流領域幅1 -x<sub>F0</sub>は単独平板よりも小さな値になり、その磁界変 化も重畳平板数が多いほど微少磁界の直線特性に近い 緩やかな増加を示す。
- (6) h<sub>e</sub><10<sup>-2</sup>の小さな微小磁界範囲において、平板端部の電流領域幅1-x<sub>F0</sub>の値に与える効果は、上下平板配列の方が左右平板列配置よりも3桁ほど小さい。
- という結果を得た。

よって、上下平板配列群の垂直磁界を0からしだいに増 していくとき、微小磁界の範囲  $h_e < 10^{-2}$ では、平板端部の 電流領域幅  $1 - x_{F0}$ の値は単独平板の場合の値と変わらず、 ほぼ直線関係  $(1 - x_{F0} \propto h_e)$ をもって増加してゆく。 $h_e > 10^{-2}$ では、 $1 - x_{F0}$ は重畳平板数が多いほど単独平板よりも 小さな値をとり、微少磁界の直線特性に近い緩やかな増加 を示す。

上下平板配列群と左右平板列群が同時に存在する実際的 な系では、二つの寄与が逆向きに働く。上下平板配列群が 密に無数に配置されるほど、磁束侵入への遮蔽が強まり、 左右平板列からの寄与が薄れていく。そして、その究極と してスラブ平板面に平行磁界の場合があると考えられる。

#### 参考文献

 野田 稔:垂直磁界下における超伝導平板中の遮蔽電 流前線II,福岡工業大学研究論集,第35巻,第2号, pp.225-230,2003.

- 2)野田 稔:超伝導平板中の遮蔽電流前線形状の磁界依存性,福岡工業大学研究論集,第36巻,第2号,pp. 193-199,2004.
- 3)野田 稔:垂直磁界中に置かれた超伝導平板内遮蔽電 流前線の平板アスペクト比依存性,福岡工業大学研究 論集,第37巻,第2号,pp.177-183,2005.
- 4)野田 稔:垂直磁界中の超伝導平板におけるベクトル ポテンシャル分布,福岡工業大学研究論集,第38巻, 第2号, pp.153-160, 2006.
- 5) 野田 稔: 垂直磁界中における超伝導薄板内の電流前 線, 福岡工業大学研究論集, 第41巻, 第2号, pp. 113-120, 2009.
- 6)野田 稔:垂直磁界中の超伝導薄板内電流前線への薄板列の影響,福岡工業大学研究論集,第42巻,第2
   号,pp.123-127,2010.
- 7) The MathWorks, Inc.
- 8) Brandt E H and Indenbom M: Phys. Rev. B48 (1993) 12893-12906
- 9) K.Yamafuji, M.Noda, T.Fujiyoshi: Effect of the Aspect Ratio of a Superconducting Tape on the AC Loss in Perpendicular External Magnetic Field, Res. Bull. Fukuoka Inst. Tech. 40, pp.199-208, 2008